

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第2区分
【発行日】平成19年11月15日(2007.11.15)

【公開番号】特開2000-81512(P2000-81512A)
【公開日】平成12年3月21日(2000.3.21)
【出願番号】特願平10-252269
【国際特許分類】
 G 0 2 B 5/28 (2006.01)
【F I】
 G 0 2 B 5/28

【手続補正書】
【提出日】平成19年9月28日(2007.9.28)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】

 【特許請求の範囲】

 【請求項1】

一方の主表面は機械加工により、他方の主表面はエッチングによりそれぞれ研磨された石英基板の両主表面に誘電体膜を備えたことを特徴とするエタロンフィルタ。

 【請求項2】

所定の厚みを有する石英基板の両面に誘電体薄膜を備えたエタロンフィルタの製造方法であって、

前記石英基板の両面を機械研磨する機械研磨工程と、
研磨した石英基板を大型基板に積層する積層基板形成工程と、
大型基板と共にエッチングを施して前記所定の厚みを得るエッチング工程と、
前記石英基板を大型基板から剥離する剥離工程と、
石英基板の両面に誘電体膜を成膜する成膜工程とからなることを特徴とするエタロンフィルタ超薄板の製造方法。

 【請求項3】

透明基板の一方の主表面と支持基板の一方の主表面とを固定してなる光学素子であって、

前記透明基板の他方の主表面と前記支持基板の他方の主表面とがエッチング加工されていることを特徴とする光学素子。

 【請求項4】

一方の主表面は機械研磨により、他方の主表面はエッチングによりそれぞれ加工されていることを特徴とする光学素子。

 【請求項5】

所定の厚みを有する光学素子の製造方法であって、
透明基板の一方の主表面と支持基板の一方の主表面とを積層する積層基板形成工程と、
前記透明基板の他方の主表面と前記支持基板の他方の主表面とをエッチング加工するエッチング工程とからなることを特徴とする光学素子の製造方法。

 【請求項6】

前記エッチング工程の後に、
前記透明基板と前記支持基板とを剥離する剥離工程を有することを特徴とする請求項5に記載の光学素子の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

【課題を解決するための手段】

上述の目的を達成するために本発明においては、一方の主表面は機械加工により、他方の主表面はエッチングによりそれぞれ研磨された石英基板の両主表面に誘電体膜を備えるよう構成したものであって、所定の厚みを有する石英基板の両面に誘電体薄膜を備えたエタロンフィルタの製造方法において、前記石英基板の両面を機械研磨し、研磨した石英基板を大型基板に接着固定し、大型基板と共にウェットエッチングを施して前記所定の厚みを得、前記石英基板を大型基板から剥離した後に、石英基板の両面に誘電体膜を蒸着することを特徴とするものである。

また、本発明における光学素子は、透明基板の一方の主表面と支持基板の一方の主表面とを固定してなる光学素子であって、前記透明基板の他方の主表面と前記支持基板の他方の主表面とがエッチング加工されていることを特徴としている。

また、本発明における光学素子は、一方の主表面は機械研磨により、他方の主表面はエッチングによりそれぞれ加工されていることを特徴としている。

また、本発明における光学素子の製造方法は、所定の厚みを有する光学素子の製造方法であって、透明基板の一方の主表面と支持基板の一方の主表面とを積層する積層基板形成工程と、前記透明基板の他方の主表面と前記支持基板の他方の主表面とをエッチング加工するエッチング工程とからなることを特徴としている。

また、本発明における光学素子の製造方法は、前記エッチング工程の後に、前記透明基板と前記支持基板とを剥離する剥離工程を有することを特徴としている。